# 業 解説

# レーザープラズマ分光法による元素分析

香川喜一郎, IDRIS Nasrullah\* 福井大学

(原稿受付:2006年12月21日)

レーザープラズマ分光分析法に関して解説を行った.短パルスのレーザーを固体に集光すると高温高密度の primary plasma が生成され、この primary plasma から原子は高速で噴出し雰囲気ガスと衝突して secondary plasma が作られその発光が分光分析に利用できる.secondary plasmaの生成には衝撃波が関与していることを実 証する実験を挙げ衝撃波モデルを説明した.実際の分析応用を行うにあたって重要な問題である、スペクトルの バックグラウンド、ミスマッチング効果、標準化法を取りあげ概説した.ミスマッチング効果はレーザープラズ マ分光分析で起こる独特の現象であり、これは衝撃波モデルで説明できること、また、それゆえに固体中に不純 物として存在する水素は、高いガス圧雰囲気下で発光効率が極端に低下することを述べた.レーザープラズマ分 光分析の装置や応用例に関しても簡単に触れた.

#### Keywords:

laser-induced plasma, shock wave, emission spectrochemical analysis, laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS, LIPS, elemental analysis, excitation mechanism

# 1. はじめに

近年のレーザーの小型化と性能向上、また光スペクトル の検出部である Optical Multichannel Analyzer (OMA) の 進歩によって、レーザープラズマを用いる発光分光分析法 は急速に普及している. レーザープラズマ分光分析法は広 く、レーザーブレイクダウン分光法(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: LIBS) といわれているが、この言葉は RadziemskiやCremersによって、レーザーによる気体中で のプラズマ生成とそれを用いたガス中の不純物元素の分析 実験で初めて使われ、その後、固体に大気圧下でレーザー を集光してプラズマ分析を行う場合に使用されてきた[1]. さらに最近では減圧下で固体のレーザープラズマ分析を行 う場合も同じ用語が使われてきている.しかし, LIBS の意 味は、レーザー照射によって放電の場合と同様な気体の絶 縁破壊が起こる現象を表現したものであり、これを一般の レーザープラズマ分光分析に適用するのは少し問題があ る. 正確には、レーザー誘起プラズマ分光法 (Laser-Induced Plasma Spectroscopy: LIPS) と呼ぶべきであろう. この LIPS の研究にかかわる研究者には以下の3つのタイ プがある.一つはレーザー応用の立場からこの分野に入り 研究を行っている場合. もう一つは分光分析を専門とし, すでに他の分析法で実績を持っている研究者がレーザーを 新しい励起源として使用する場合、さらに研究の必要性か ら LIPS 法を各自の研究に取り入れ活用する場合である. 我々は最初の部類に属し、25年前、N2レーザーを改良しな がらこの方面の研究を開始した[2]. レーザー光をレンズ

で集光しさえすればプラズマが発生し発光するので, LIPS 法は一見だれでも簡単に使用できる分析法のように思われ る.しかし実際に定量分析を行うとなるといろいろな問題 がある.レーザープラズマの発生過程,またそれにともな うプラズマの膨張・拡散過程はかなり複雑な現象であり, 雰囲気ガス圧、レーザー光のパワー密度、また試料の特性 等によって大きく影響を受ける. レーザープラズマが放出 する原子の発光を用いて分析を行うこの LIPS 法では、ア ブレーションによって雰囲気ガス中に放出された原子がど のような励起過程を経て発光するかを、ある程度モデル的 に理解しておく必要がある. それに基づいてより分析に適 した特性を持つプラズマを発生させるための条件設定が可 能となる.このような観点から、「分光分析のためのレー ザープラズマ生成技術」という言葉が存在し得ると考えら れる.これまで、レーザープラズマ分光分析法の応用に関 しては非常に沢山の研究が行われてきたが、そのプラズマ 発光のメカニズムに関してはあまり研究が進んでいなかっ た. 我々はこの発光のメカニズムに関する研究を継続して 行い、衝撃波がプラズマ発光過程に重要な役割をしている とする「衝撃波モデル」を提案し[3,4],それを証明するた めの実験的研究を行ってきた. ここでは、初めてこの分野 に触れられる方のために、できるだけわかりやすく LIPS 法に関して解説したい.気体や液体の元素分析もレーザー プラズマを用いて行うことができるが、ここでは省略し、 主に固体のレーザープラズマ分光分析に関して述べる.

Emission Spectrochemical Analysis Using Laser-Induced Plasma Spectroscopy KAGAWA Kiichiro and IDRIS Nasrullah\*

corresponding author's e-mail: kagawa@edu00.f-edu.fukui-u.ac.jp

\*Permanent Address: Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Syiah Kuala University, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia

#### 2. 原子発光スペクトル分析法

原子発光スペクトル分析法は19世紀中ごろのブンゼンや キルヒホフの研究に始まり長い歴史を有する. この原理は 原子の一番外側の軌道にある電子が、よりエネルギーの高 い軌道に励起され、そこから下の軌道に遷移するとき、そ のエネルギー差が光となって放出されることを利用するも のである (図1(a)). 原子中の電子軌道のエネルギーは不 連続であり、そのエネルギーの値も元素によって異なって いる.したがって原子から放出する線スペクトルの波長を 調べることで元素の同定が可能となり、また、その発光線 の強度から、試料に含まれる元素の濃度に関する情報が得 られる.問題は原子をいかにして励起するかであり、その ためのいろいろな方法がとられてきた.基本的方法として は、原子を気化させると同時に原子が励起されるだけの高 温を与えることである. それゆえにこの分析法では数千度 以上のプラズマが必要となる. ブンゼン・キルヒホフはそ のために火炎(化学フレーム)を用いたが(図1(b)),そ れで得られる温度はせいぜい2000K程度であり、励起エネ ルギーの高い元素はこのフレーム法では分析することはで きない. その後アーク放電プラズマや、スパーク放電プラ ズマが分析用光源として使われた(図1(c)).近年アルゴ ンガス中に作る高周波誘導結合プラズマ(略して ICP プラ ズマ)が発光分光分析用の光源として確立した方法となっ ている (図1(d)). この場合、プラズマの温度は約8000 K





図1 原子発光スペクトル分析法と種々のプラズマ生成法.

と高く,またプラズマの熱容量は大きく,かつプラズマの 安定性が非常に高いことから,精度の高い高感度分析法と して広く利用されている.しかしながら,装置が大型であ ること,試料は液体にしたのち,霧状にしてプラズマの芯 部分に送らねばならないなどの制約から,その場分析装置 としては利用することはできない.発光分光分析のための プラズマ状態を得る方法として図1(e)に示すような衝撃 波管が用いられることもある.これは,高圧ガス部分と低 圧ガス部分を金属製の薄い膜で仕切り,その膜を尖った金 属性の針で瞬時に破ることで発生させられる.高圧ガスは ピストンのごとく高速で低圧ガスを圧縮し,その断熱圧縮 によって数千度のプラズマを作ることができる[5].

# レーザープラズマとレーザープラズマ分光分 析法

原子発光スペクトル分析法において、レーザーを用いて 励起に十分なエネルギーをもつプラズマを作る方法がレー ザー誘起プラズマ分光分析法 (LIPS) である. この研究は、 代表的なレーザーの応用の一つとして、レーザーの発明直 後から始まった[6]. この方法は、レーザーを試料表面に集 光するのみで瞬時にプラズマを発生させることができる (図1(f)).即ち、試料の蒸発・気化・励起をレーザー照射 という単一操作で行うことができるのがこの方法の特徴で ある.また、レーザープラズマ法の利点は、試料がごく少 量で済むこと、レーザー光が集光されるスポット部分のみ がプラズマ化するため、微小領域分析ができることも大き な特徴である.

図2はN<sub>2</sub>レーザー(波長 337 nm, パルスエネルギー8 mJ, パルス幅6 ns)を,雰囲気ガス圧1気圧(a),1 Torr(b),0.1 Torr(c)の異なる条件で,金属板に集光したときに生じる プラズマの様子を示す.このように雰囲気ガス圧によって 発生するプラズマの様子は大きく異なる.1気圧の場合, プラズマは強い連続スペクトルを放出し全体が白色に見え る.雰囲気ガス圧を減圧すると,プラズマは発光の様子の 異なる2つの領域からなることが明瞭にわかる.すなわ ち,一つは小さい白色のプラズマである.これは primary plasma とよばれる高温高密度(数-数+ eV, 10<sup>23</sup> - 10<sup>24</sup>/ m<sup>3</sup>)のプラズマである.もう一つは,primary plasma を取 り囲むように半球状に広がり,原子の輝線スペクトルを放 出するプラズマである.このプラズマは secondary plasma と呼ばれる.これは試料の構成元素に応じた独特の色を発



図2 N<sub>2</sub>レーザーを金属試料に照射したときのプラズマ:雰囲気ガス圧は(a)1気圧,(b)1Torr,(c)0.1Torr.

する.例えば、銅の場合は鮮やかな緑色であり、亜鉛の場 合は赤味がかった青色となる.primary plasma はレーザー 照射開始後数nsで立ち上がり、レーザーのパルス幅程度の 時間、強い連続スペクトルを放出する.secondary plasma はこの primary plasma から発生し、時間とともに広がり、 発光は数 $\mu$ sの間続く.肉眼では時間的に積分するため半球 状に見える.同じ雰囲気ならばプラズマ発光領域の半径は レーザーのパルスエネルギーに依存し、エネルギーの増大 とともにプラズマ発光の半径も大きくなる.N<sub>2</sub>レーザーの 場合、雰囲気1Torrで約1cm程度である.secondary plasmaの半径は雰囲気圧を減少させると増大するが、発光 の輝度は下がる.雰囲気圧が 0.1 Torr 以下になると secondary plasma の形状は不鮮明となるとともに、プラズマ全 体の発光強度は著しく減少する.

図3は primary plasma 生成過程の概略を示す. レーザー



図 3 Primary plasma の生成過程.

光が照射されると固体の表面で吸収が起こり表面近くは高 温となり原子の気化が始まる.原子の一部はイオン化され 電子が放出される.レーザー光のパワー密度(W/cm<sup>2</sup>)は 高いので多光子過程で吸収やイオン化も起こる. また多光 子過程による光電効果によって電子が表面から放出される 場合もある. 放出された電子は光の電場を受けて加速され エネルギーを得る(逆制動放射).エネルギーを得た電子は 原子と衝突し、これを励起・イオン化する. これによって 電子は増殖されレーザー光のエネルギーはますます効率よ くプラズマのエネルギーに転化する. これがプラズマによ るレーザー光の吸収であり、これによってプラズマの温度 は急激に数万度へと上昇する.この温度によって試料の表 面は溶かされ、溶かされた原子はプラズマの中に入ってく る、レーザーパルスが終わるとプラズマの更なる加熱はな く、プラズマは高速度で膨張するのみである.このプラズ マの膨張の慣性によって原子・イオンは超高速度で primary plasma から噴出される.

炭酸ガスレーザーのように,波長の長い(振動数は小さい)レーザー光を大気圧のような高いガス圧中で金属表面 に集光する場合,YAGレーザー等を用いる場合とは異 なった現象が現れる.即ち,金属表面から放出された初期 の電子は振動数の低い光の電場のもとでより高い運動エネ ルギーに加速され,試料表面近くのガスを強く電離させ初 期のプラズマを作る.これによってレーザー光は吸収さ れ,プラズマの密度が上昇する.するとさらにレーザー光 が吸収されて金属試料には到達できず,金属表面からのア ブレーションは全く起こらない.

LIPS法には現在異なる2つの研究の流れがある.一つは 1981年, Radziemski のグループで始められた方法で, 大気 圧下で YAG レーザー等の短パルスレーザーを照射する [7]. この場合プラズマ発生の初期で強い連続スペクトル が放出されるのでこれを除くためにゲート付きのOMA を用いてスペクトル計測が行われる。もう一つは同じころ 我々らによって始められた方法であり,数Torr付近の減圧 下でレーザー照射する減圧下レーザープラズマ法である [2]. この場合, 上でも述べたようにスペクトルバックグラ ウンドの低いsecondary plasmaが発生するのでゲートなし の OMA でも十分分析ができる. あとで述べるように, 現 在では大気圧でできるレーザープラズマも減圧下でできる レーザープラズマも基本的には同じメカニズムによること がわかっている.しかし,原子の励起・発光のメカニズム を研究する場合、空間的により大きく広がって発光する減 圧下プラズマを用いて研究する方が有利であり、本稿にお いては以下我々が行った減圧下生成secondaryplasmaの励 起・発光機構について述べる.

#### 4. レーザー誘起衝撃波プラズマ

エネルギーが数Jのパルスエネルギーを固体に集光し, 減圧した雰囲気中に衝撃波を発生させる実験はBasovらに よって始められ,その後いくつかの研究が行われた [8-10].しかし,数mJから数十mJの比較的低いエネル ギーのレーザー光を用いた場合でも衝撃波が発生すること や、衝撃波とプラズマの発光の間に密接な関係があること は知られていなかった. 我々はN2レーザーを用い減圧下で のプラズマの特性を調べ、プラズマ発光の先端の移動が、 Sedov[11]によって理論的に導かれた点爆発で発生する衝 撃波の式でよく説明できること、また、原子スペクトル線 を空間的に積分して測定した全発光強度は、primary plasma 消滅後,時間とともに増大し1µs付近で最大となっ たのち減少すること、さらに、励起エネルギーの異なる2 本の原子発光線の強度比からボルツマン分布を仮定して求 められるプラズマの温度は、やはり1µs付近で最大(約 8000 K) となることから衝撃波がプラズマの発光に関与し ていると考えた[4]. 即ちこれらの実験結果から、プラズマ 発光にアブレーションした原子による圧縮過程(時間遅れ がある)が関係していることが窺える. さらに, 雰囲気ガ ス圧を1 Torrよりさらに0.1 Torr付近に下げるとプラズマ の全発光強度は急激に減少する事実は, secondary plasma の生成に、アブレーションした原子と雰囲気ガスとの相互 作用が必要であることを強く示唆している. その後、サン プリング法を使用した時間分解空間分布測定法を考案し, TEA CO<sub>2</sub>レーザー (波長 10.6 µm, パルスエネルギー 500 mJ, パルス幅 200 ns) や XeCl エキシマーレーザー (波長 308 nm, パルスエネルギー 50 mJ, パルス幅 20 ns)を用い たレーザープラズマの発光の挙動を調べ[12,13],プラズ マの発光が薄い層状構造を持って広がっていくこと、ま た、イオンの発光の立ち上がりは中性原子のそれに比べ遅 れることを確認し、衝撃波管を用いた高温・高速衝撃波で 見られる現象と一致していることを明らかにした[13].こ の時間分解空間分布測定は図4の装置に示すように、レー ザー集光レンズとターゲットを取り付けた真空チャンバー

を一体とし、レーザーの進行方向と同じ直線上を適度の速 度で移動しながら、サンプリングオシロスコープを用いて レーザー照射後のある特定時間のみの発光信号を捕らえ、 その信号の時間変化から発光の空間分布を求める方法であ る.このとき、ターゲットである試料を回転しつつレー ザー照射を行い、常にほぼ同じ形状と強度を持ったレー ザープラズマを生成するようにしている.

衝撃波モデルのより直接的な証拠を得るために、衝撃波 の位置とプラズマ発光の先端の位置の関係を図4に示すよ うな干渉計を組み合わせた装置を用いて調べた[14].即 ち, He-Ne レーザーをプローブ光として用い, 減圧チャン バーを通過させたのち,円柱状のガラス棒(直径 60 mm)に 虹の原理に関係する最小振れ角の条件になるように入射さ せる. それによって複雑な光学系なしに干渉縞を作ること ができる. 衝撃波がプローブ光にさしかかるとガス密度の 急激な変化 (density jump) により干渉縞は乱れる. それを オシロスコープのCh.2で検出する.一方プローブ光が通過 する同じ場所でのプラズマの発光の時間変化をモノクロ メーターと光電子増倍管を用い Ch.1 で測定する.図5に TEA CO<sub>2</sub>レーザーをガス圧 10 Torr でガラス試料に照射し たときの結果を示す. 試料表面から5mmの位置では,発 光の立ち上がりとdensity jumpの信号は完全に一致してい る.しかし、距離とともに発光の立ち上がり時間が、density jump の立ち上がりに対して遅れていくのがわかる.こ の density jump と発光の先端の関係は、YAG レーザー(波 長 1.06 µm, パルスエネルギー 13 mJ - 50 mJ, パルス幅 8 ns)を用いた実験でも確認できた[15].

衝撃波モデルを支持するもう一つの現象は、レーザー照 射する試料の前に細い針やワイヤーなどの障害物を置く



図 4 Secondary plasma 発光の時間分解空間分布、および secondary plasma の発光の先端と衝撃波の位置関係を測定する装置.



図5 TEA CO<sub>2</sub>を減圧下でガラス試料に照射したときの発光とガス密度変化の信号.

と、プラズマの発光は通常の半球状から大きく変形される が、その発光の形状は、一点から発生した衝撃波が、障害 物によって変形されてできると予想される衝撃波の形状に ほぼ一致していることである[16].図6(a)は亜鉛のター ゲットの前に細い針を1本試料と平行に置き、TEA CO<sub>2</sub> レーザーを照射した場合であり、V字型の発光構造が見ら れる.これは高速で動く弾丸の周りにできる衝撃波構造に 対比している.図6(b)は2本の細いワイヤーをターゲッ トの前に試料と平行に張り、その中央にTEA CO<sub>2</sub>レーザー を集光した場合である.2つのV字型衝撃波が干渉し、中 央に向かって進む強い発光が現れていることがわかる.

さらに、TEA CO<sub>2</sub>レーザーを用いるときの顕著な現象と して、軟らかい試料ではプラズマが発生しないことがある [17,18].この事実も衝撃波モデルを支持している.即ち試 料が軟らかいと、原子がアブレーションするとき、反作用 が不十分なため噴出する原子の速度が低下し、そのために 衝撃波が発生できないと考えられる.しかし、その試料を 薄くして金属板上に密着させると容易にプラズマが発生す る.背後に硬い物体があることで十分な反作用が生まれ、 高速での原子噴出が可能となり、衝撃波を誘起すると考え られる.これをサブターゲット効果と呼んでいる.YAG レーザーはパルス幅が TEA CO<sub>2</sub>レーザーに比べてはるか に狭くパワー密度が高いので、このサブターゲット効果は 顕著には現れない.

以上のような事実に基づき,我々は図7に示すような衝撃波モデルを提案した[13].まず,レーザー照射によって 径の小さな primary plasma が発生する.この primary plasma から原子は超高速(数+km/s)で噴出し,雰囲気 ガスと衝突を繰り返し,前方で原子の壁が形成される.こ の原子の壁がピストンのように作用し雰囲気ガスを圧縮し



図 6 ターゲット前の障害物によって変形した TEA CO<sub>2</sub>レーザー 誘起 secondary plasma: (a) 1本の細い針を置いた場合, (b) 2本の細いワイヤーの場合.



図7 Secondary plasma を説明する衝撃波モデル.

て衝撃波を発生する.原子の壁の後方では、次々と高速で くる原子に押されて断熱圧縮が起こり、高温状態となり原 子は励起・発光する. それは図1(e)で示す衝撃波管で起 こる現象に似ている.初期の状態では、原子の壁と衝撃波 は重なっているが、時間が経過するにつれ原子は運動量を 失い衝撃波から離れていく.このモデルの特徴は、 試料か ら噴出する原子の運動エネルギーが熱エネルギーに転化し て原子を励起するという考え方である. レーザープラズマ 発光を説明するモデルとして,他に電子衝突モデルや [19], 電子・イオン再結合モデル等があるが[20], これら のモデルでは上記の実験結果をうまく説明できない.ま た, secondary plasma 中の電子数の時間変化を,金属試料 と試料の前に置いた金属メッシュ間に電圧をかけ、誘導電 流信号の時間変化から推定した結果、電子数と分析原子の 発光の時間変化の間に相関がないという、我々の別の実験 結果をも、これらのモデルでは説明できない[21,22]. 雰囲 気ガス圧が大気圧であっても,基本的には衝撃波が関与し たメカニズムによって原子は励起されていると考えられる [23, 24]. また,他の研究者によっても,それを指示する実 験結果が示されている[25].

#### 5. スペクトルのバックグラウンド

他のスペクトル分析と同様, LIPS法の場合もスペクトル のバックグラウンドレベルが分析感度を左右する. レー ザープラズマのバックグラウンドはガス圧とガスの種類で 大きく変化する. 図8は XeCl エキシマーレーザーをガラ ス試料に空気1気圧(a), He1気圧(b), He 10 Torr(c)で 照射したときのプラズマの発光スペクトルである[26].ス ペクトルはOMA (愛宕物産: Max320, 焦点距離0.32 m, 回 折格子1200本/mm 分解能 0.2 nm)を用い,時間的・空間的 に積分して得ている. ガラス中に含まれる Al, Caのスペク トル線が見られるが、条件によってスペクトルのバックグ ラウンドは大きく異なる. primary plasma それ自身の強度 はガス圧やガスの種類に殆どよらないが, secondary plasmaの初期の発光において,雰囲気ガス条件はバックグ ラウンドに大きく影響する. 図からわかるように空気の場 合は He に比べてバックグラウンドが相対的に高い. また 線スペクトルの幅も空気の方が大きい. He は雰囲気ガス の中で最も低いバックグラウンドを与えてくれる. これは 主に He のガス密度が小さいことと、He のイオン化エネル ギーが高いことによっている.He1気圧はガス密度で表す と空気 108 Torr 付近の密度と同じである. 衝撃波プラズマ においてはセドフの式が示すように、ガス圧ではなく、ガ ス密度によって衝撃波の広がりが決まる[4]. アブレー ションした原子が早く広い領域に広がる場合はスペクトル のバックグラウンドは低くなる.しかし、ガス密度の高い 状態でアブレーションが起こる場合はアブレーションした 原子のイオン化が進み、スペクトルのバックグラウンドは 高くなる.バックグラウンドとなる光は、プラズマ中での イオンと電子の再結合や、イオンの周りでの電子の制動放 射によって発せられるため、イオン化の度合いがバックグ ラウンド発光の強さに関係している.



図8 XeClエキシマーレーザーをガラス試料に照射したときの 発光スペクトル:(a)空気1気圧,(b)He 1気圧,(c)He 10 Torr.

He 10 Torr の雰囲気の場合は、スペクトル線幅は狭くなり、バックグラウンドも相当下がっている(図8(c)).これらの結果が示すように分析応用のためには減圧下でレーザープラズマを作る方が有利であるが、その場分析という利点のために一般には大気圧で分析が行われる。大気圧下でのレーザープラズマ生成の場合も、ゲート機能を有するOMAを用いれば、バックグラウンドが高くスペクトル広がりを起こしているレーザープラズマの初期のスペクトルをカットして後半のsecondary plasmaからの発光のみを計測することができる。これによってスペクトル特性はかなり改善される.

雰囲気ガス条件が同じでも,使用するレーザーのエネル ギーや集光度によってもバックグラウンドは大きく変化す る.レーザーのエネルギー密度を上げ過ぎるとスペクトル 線強度とバックグラウンド強度の比(*S/B*)は小さくなり分 析上不利である.これは,高いパワー密度で試料を照射す ると,超高速の衝撃波が駆動され,それによって原子のイ オン化が進み,その結果スペクトルのバックグラウンドが 高くなると考えられる.これはLIPS 法を用いて分析する 場合の重要なポイントである.

減圧下生成のレーザープラズマの場合においても secondary plasma の初期ではイオン線の発光強度は強く、バッ クグラウンドも高い. 図9はTEA CO2レーザーを1Torr の減圧下で Zn 試料に集光した場合の時間分解スペクトル である[27]. プラズマの発光は空間的に積分して測定して いる. レーザー照射後 300 ns 付近までは連続スペクトルと なっているがその後Znのイオン線の発光が強く、4µs以後 ではイオン線の強度は下がり Zn の中性線の発光強度が強 くなっている.この時間ではスペクトルのバックグラウン ドは十分低くなっている.したがって減圧下生成レーザー プラズマの場合も、ゲート機能を有した OMA を使うこと は分析感度を向上させるために効果的である.減圧下生成 レーザープラズマの場合に適用できる S/B を向上させるも う一つの方法は, secondary plasma の像を, 凸レンズを用 いて分光器のスリット面上に結像し、試料表面から少し離 れた (5-10 mm) 部分の発光がスリットに入るよう調整し てスペクトル計測する方法である. その領域ではすでに バックグラウンドは低く純度の高い原子スペクトル線が測 定される[13]. またこの場合、ゲート機能を持たないより 安価な OMA が使用できるというメリットがある.

#### 6. ミスマッチング効果

上で述べた衝撃波モデルが正しいとすれば、原子の噴出 時間と衝撃波発生時間との時間差によって、原子は試料か ら噴出しながらも十分励起・発光が起こらないケースがあ り得る.我々はこの現象をミスマッチングと呼んでいる. 特に母体元素に比べ、分析元素の質量が大きく異なる場合 ミスマッチング効果が無視できなくなる. 衝撃波は母体元 素のアブレーションで誘起されるが、質量が軽い原子は衝 撃波が発生する前に高速で噴出し、衝撃波が発生したとき はすでにその前方に出ており、励起・発光が有効に起こら なくなる.実際,水素のレーザープラズマ分析において, 雰囲気ガス圧が高いときこの現象が起こっていると思われ る. これまで LIPS 法で固体中に不純物として存在する水 素の分析は行われていなかった. 最近, 我々は, 減圧下生 成レーザープラズマ法で水素の分析ができることを明らか にした[28,29]. 図10はガラスを試料として測定した水素 Ha のスペクトルであり, (a)が1 Torr, (b)が大気圧の場 合である. 図11はガラス試料から得られる, Ha, Si(I)288.1 nm, O(I)777.1 nm 発光に関するガス圧特性である. Ha の発光は1 Torr から 100 Torr の間で急激に減少している のがわかる.この発光の減少がプラズマ温度の変化によら ないことは、Hαの場合とほぼ近い励起エネルギーを持つ



図10 ガラス試料を用いて測定した水素の発光スペクトル:(a) 1 Torr, (b) 1 気圧.

O(I)777.1 nm では, 逆に発光効率はガス圧とともに増大し ていることからわかる. 最近, 我々は質量の小さい Li と質 量の大きい Pb を含む試料を作成し, これらの元素の発光 強度のガス圧依存性を調べ, やはりミスマッチング効果が 起こっていることを明らかにした[30]. これまで多くの LIPS法を用いた論文において, 分析結果が母体の種類が変 Laser energy : 500 mJ



図11 ガラス試料から得られる H, Si, O の発光強度の雰囲気ガス圧依存性.

わることによって変化する現象を単にマトリックス効果と 表現し、その原因に関しては殆ど説明を加えなかったが、 それらの多くはミスマッチング効果によるものと考えられ る.ミスマッチング効果からくる分析上の誤差はある程度 避けられない.これは試料の蒸発・気化と原子の励起を単 一のレーザーで行おうとする LIPS 法の宿命でもある.し かし、このことを意識して LIPS 法を使用するならば大き な間違いは起こらないであろう.

#### 7. 定量分析と標準化法

ICP 分析法などで試料の定量分析を行うには、標準試料 を用いてあらかじめ元素濃度とスペクトル線強度の関係を 検量線としてグラフにしておき、分析試料から得られるス ペクトル発光強度からそれに対応する濃度を検量線から求 める. LIPS法においても分析試料とほぼ似た母体特性を持 つ標準試料が得られる場合は同様の方法で定量分析ができ る.しかし、この場合でもレーザーの出力やレーザーの集 光度等のわずかな条件の違いや、さらに試料表面の汚れや 表面の粗さ等にも影響され、プラズマ発光強度は試料を置 き換えるごとに変化する.これを補正するために通常内標 準法が使われる.即ち、母体元素の発光線の中で分析する 元素の分析線の励起エネルギーに比較的近い励起エネル ギーを持つスペクトル線強度を内標準線として測定しそれ らの発光強度比を用いる.内標準に用いるスペクトル線が 分析線の波長付近に存在しない場合は別のOMAまた は、モノクロメーターと光電子増倍管を組み合わせた方法 で内標準線を測定する必要がある.図12は鉄鋼標準試料を 用いて作成したCrの検量線である[31].減圧下でレーザー プラズマを生成し、Cr(I)425.4 nmとFe(I)425.0 nmの比を 濃度に対してプロットしている.雰囲気ガス圧が1Torr の場合はよい直線関係があるが,ガス圧が7Torrと高くな ると検量線は曲がり,高濃度になるにつれ発光強度が飽和 する傾向にある.ここで測定したCr(I)425.4 nm は共鳴線 であり,ガス圧が高くなると自己吸収効果がある程度起 こっていると考えられる.圧力が1Torrのように低い場 合,衝撃波プラズマは薄い層状構造を持って大きく広がっ ていく[12].このような薄い層状構造から原子の発光が生 じる場合は,自己吸収は起こりにくい.一方,圧力が高く なると衝撃波プラズマの広がる領域は狭くなり,アブレー ションした原子は厚い層で分布する.そのような状況下で は自己吸収が起こりやすくなる.LIPS法では,自己吸収が 起こりにくく,かつ高い発光効率を持つスペクトル線を分 析線として選択する必要がある.

LIPS法の一つの特徴は迅速性であり,定量の精度は悪く てもおおよその濃度を知るために使われることもある.分 析試料に近い母体特性を持つ標準試料が用意できない場合 や,主成分そのものの濃度がわかっていない場合もある. そのような場合の標準化法としていくつかの方法が考えら れる.減圧下生成プラズマの場合は primary plasma と secondary plasma が完全に分離して測定され,かつ primary plasma の強度は試料からアブレーションする量にほぼ比 例していることがわかっているので,primary plasma 強度 を測定して標準化することができる[32,33].また,小型の OMA (Lambda Vision 社:SA-100-HPCB)を用いて,200 nm 付近から 1000 nm 付近までの広いスペクトル領域を測 定し,その積分値を用いる方法も考えられる.最近我々は, レーザー加工のモニタリングのために,試料の上部に電極 を配置し,プラズマによる誘導電流を測定しているが,こ



図13 レーザープラズマ分光分析装置の概念図.

の誘導電流信号もアブレーション量と比例関係を持っており、レーザープラズマ分析の標準化に利用できると期待される[34]. LIPS法においてこの標準化の問題は今後さらに 研究されなければならない課題である.

### 8. LIPS 法の装置

図13は LIPS 法のための測定装置の概念図である. LIPS 分析のために使用されるパルスレーザーはそれほど多くな い.一般に使われるのは基本波(1064 nm)の Nd:YAG レー ザー(パルス幅約 10 ns)で,通常,パルスエネルギーは数 十 mJ から数百 mJ に調整され,パルスの繰り返し発振周波 数は10-20 Hz で使用される.目的によっては Nd:YAG の 2 倍波(532 nm), 3 倍波(355 nm), 4 倍波(266 nm) が使われこともある.紫外部のレーザーで出力の高いレー ザーが必要な場合は XeCl (308 nm), KrF (248 nm), ArF (194 nm) などのエキシマーレーザーが使われる.遠赤外領 域に発振波長 (10.6  $\mu$ m)を持つパルスの TEA CO<sub>2</sub>レーザー (パルスエネルギー数百 mJ, パルス幅約 200 ns)も分析対 象によっては非常に効果的であり,我々の研究ではよく使 用している.紫外部に発振波長 (337.1 nm)を持ち高繰り返 し発振が可能な N<sub>2</sub>レーザー (5 mJ, 5 ns)も目的によって は非常によいプラズマ発生の光源となる.

レーザー光は通常焦点距離が 10 cm から 20 cm 程度の凸 レンズで分析試料に集光される.少し離れた位置から遠隔 的に対象物の元素分析を行う場合は 1 mから数mの焦点距 離の凸レンズが使われときもある.殆どのレーザーに対し

ては純度の高い石英製の凸レンズが使用されるが、CO<sub>2</sub> レーザーの場合はレーザー光が吸収されるので ZnSe の凸 レンズを使用する.分析試料を自動微動ステージに乗せて 移動させ試料表面の元素分布のマッピングを得ることも可 能である. 試料が動かせない場合は、レーザービーム自体 を走査する方法が採用される.5章でも述べたが、レー ザーの集光度はプラズマの特性に大きく影響する. レー ザー光を試料表面の手前で集光するとターゲットプラズマ に加えてガスが強くプラズマ化し、それがスペクトルの バックグラウンドを高めるので注意を要する.通常、レン ズと試料表面の距離はいくらかレンズの焦点距離より短く なるようわずかに defocus 状態で集光する.減圧下でプラ ズマ生成した方がスペクトルのバックグラウンドは低く分 析感度は高い.しかし試料を切断して真空チャンバーに入 れて測定しなければならないという難点がある.これに関 して、我々は図13(挿入図)に示すように 0 リングの付い た小型真空チャンバーを分析試料表面に吸着させてその中 にレーザー光を集光しプラズマを作る方法を提案している [35].

レーザープラズマの発光は通常光ファイバーで受け、ス ペクトル検出器である OMA に導かれる. 光ファイバーに はその発光を捕らえることのできる視野角があり、それを 考慮して光ファイバーの位置を決める. レンズを用いてプ ラズマ発光を光ファイバーに入れる場合もある.光ファイ バーの出口と分光器の入り口スリットとのカップリングは 非常に大事であり、分光器の入り口スリットの前に置かれ る光ファイバーの先端の形状がスリットと同様な縦長に なっている方がよい. 遠隔的分析の場合, かなり離れた位 置にレーザープラズマを作り分析を行うので、プラズマの 発光を大型ミラーや大口径の望遠鏡で集めそれを OMA に導くことが必要となる. OMA は光を波長によって分け る分光器と、光を電気信号に変える光検出素子(CCD)か らなる.通常波長分解能としては0.1 nm 程度のものが使用 されており、一度に測定できるスペクトル領域は40nm 程度である.分析線のそばに近接した発光線があり妨害を 受ける場合は、分解能が 0.01 nm 程度の性能をもつ高分解 能OMA が必要となる.しかし、一度に測定できるスペク トル領域は狭くなる. 最近は分解能も優れ, かつ一度に広 いスペクトル領域が観測できるエシェルタイプの分光器を 用いた OMA が使用されている.プラズマ発光のスペクト ルはレーザー1ショットでも得ることができるが, S/N (信 号とノイズの比)を向上させるために通常の固体試料に対 しては100-200ショット連続して照射し、スペクトルを積 算している、5章でも述べたように、レーザー照射直後の プラズマの発光スペクトルはバックグラウンドが高いの で、ゲート機能を持った光検出素子 (ICCD) を用い、適当 な時間差をつけてスペクトル計測を行っている.図14は土 壌試料に TEA CO<sub>2</sub>レーザーを照射した場合であり、(a)は ゲートを用いない場合のスペクトルであり、(b) はゲート 開始時間を10µsとした場合である.(b)のスペクトルは (a)に比べてバックグラウンドが抑えられ、分析線 Pb(I) 406 nm がより明瞭になっているのがわかる.



図14 Pbを含む土壌試料に大気圧下でTEACO<sub>2</sub>レーザーを照射したときの発光スペクトル:(a)OMAのゲートない場合,(b)OMAのゲート開始時間を10 µsとした場合.

#### 9. LIPS 法の応用

固体の元素分析法には、すでに十分確立し分析装置とし て市販されているものがいくつかある. それらに比べると LIPS法はまだ十分成熟していない分析法である.分析感度 は通常の条件で数十 ppm から数 ppm であり,分析感度・ 精度等に関して決して優れた分析法とはいえない.しかし 他の分析法では前処理が必要であったり、分析試料を適当 なサイズに切り出して分析装置の中にセットしなければな らないのに対して、LIPS法ではその場・迅速分析ができる ことが最大の特徴である.また分析に必要な試料はごく少 量であるため,殆ど非破壊分析に近い分析が可能であり, 考古学的に貴重な試料等に対しても適用できる特徴を持っ ている.近年蛍光 X 線分析装置が小型化されいろいろの分 野でその場元素分析法として使用されており, LIPS法と競 合することが多い.しかし試料表面を2次元的に空間分解 して分析する分解能はレーザーの場合がはるかに優れてい る. また蛍光 X 線分析では表面から深さ方向に平均化した ものを測定するのに対して, LIPS法では表面から深さ方向 にレーザー照射によって少しずつ剥ぎ取りながら分析する ことができる.この深さ分解能は約0.1 um ほどである.さ らに蛍光X線分析法では軽元素に対する感度が低いが LIPS法は水素から始まり殆どの元素分析に適用できる.分 析対象物が距離的にある程度離れていても遠隔的方法で分 析できるのも他の分析方法では真似のできないところであ る. 光ファイバーでレーザー光を送り水中にある原子炉材 料表面に付着した不純物元素を LIPS 法で分析した例が報 告されているが、これらは LIPS 法の特徴を生かした典型 的な応用である[36]. 最近我々は LIPS 法を用いてコンク

Commentary

リートの中性化検査や、コンクリートの硬さ検査への応用 を行った[37,38].また、LIPS法による水素分析の応用と して、軽水炉型原子炉の燃料被覆管として使われるジルカ ロイの水素分析の研究を行っている[29,39-41].これは原 子炉の水素脆化の問題に挑戦する新しい測定法として注目 されている.また、重水素と水素とでは同位体効果によっ て Ha の線スペクトルの波長がわずか0.179 nm ずれている が、我々は LIPS法でこれを分離して測定することに成功 している[42-44].他の研究者によるいろいろな LIPS 法の 応用に関しては、最近出版された解説書を参考にしていた だきたい[36,45].

#### 10. おわりに

レーザープラズマ分光分析法は、今後ますます多くの分 野で利用されることは間違いないであろう. 原子スペクト ルを利用するという点では, 従来のアーク放電や ICP プラ ズマ分光分析と同じであるが, LIPS法の場合は定常的なプ ラズマではなく,非常に高速で変化するプラズマを用いる という大きな違いがある. それゆえその物理的背景を十分 把握した上で分析に利用する必要があり、今後も LIPS 法 に関する基礎的な研究が要求される.本稿では触れなかっ たが、最近のこの分野の新しい傾向として、2台のレー ザーを同期させ、1台のレーザーでアブレーションさせた 後,もう一つのレーザーを原子が滞在する雰囲気中に集光 してプラズマを作り再励起する方法がある.この方法を2 重励起法と呼んでいる[46]. この方法の採用で LIPS 法の 元素の検出感度はかなり向上してきている.我々は主に大 気圧下での水素分析の実現を目的として,異なった2重励 起法の検討を行っている. 即ち, He 1 気圧で TEA CO<sub>2</sub> レーザーを金属表面に集光して He のガスプラズマを作り その結果多量のHeの準安定状態生成させ、このHeの準安 定状態を介して YAG レーザーでアブレーションさせた原 子を励起する方法である[47]. この方法はスペクトルの バックグラウンドが低く、また水素からハロゲン元素等を 含む殆どの元素を高感度で分析できる可能性があり、今後 この研究を展開する予定である.

最後に本分野における我が国の現状を述べておく.日本 においても2000年代に入り「研究の必要性からLIPS法を各 自の研究に活用する」ケースを中心に,新たに本分野に注 目し参入する研究者が増加している.この現状を受けて, 平成17年に日本分光学会の研究部会として"レーザー誘起 プラズマ分光部会"が設立され,現在活発に研究が行われ ている.

#### 謝辞

本稿で紹介した研究は元大阪工業試験所の中島貞夫先生 やインドネシア Maju Makmur Mandiri Foundation 研究セ ンターの Dr. Hendrik Kurniawan らとの共同研究として 行ったこと,また,ジルカロイ中の水素分析に関しては東 京工業大学,統合研究院の丸山忠司教授,福井大学大学院 工学研究科,原子力・エネルギー安全工学専攻の仁木秀明 教授,福元謙一助教授らの協力を得たことを述べ感謝いた します. さらに LIPS 法のコンクリートへの応用研究は鹿 島技術研究所との共同研究の成果であり、ここに謝意を表 します.

#### 参考文献

- [1] L.J. Radziemski and D.A. Cremers, Spectrochemical Analysis Using Laser Plasma Excitation, in Laser-Induced Plasmas and Applications, eds. L.J. Radziemski and D.A. Cremers, Marcel Dekker (New York, 1989) Chp. 7, p. 295.
- [2] K. Kagawa and S. Yokoi, Spectrochim. Acta B, 37, 789 (1982).
- [3] K. Kagawa, S. Yokoi and S. Nakajima, Opt. Com., 45, 261 (1983).
- [4] K. Kagawa, M. Ohtani, S. Yokoi and S. Nakajima, Spectrochim. Acta B, 34, 525 (1984).
- [5] 神沢淳:現代化学 18,52 (1972).
- [6] F. Brech and L. Cross, Appl. Spectrosc. 16, 59 (1962).
- [7] T.R. Loree and L.J. Radziemski, Plasma Chem. Plasma Proc. 1, 271 (1981).
- [8] N.G. Basov, O.N. Krokhin and G.V. Skilzkov, JETP Lett.
  6, 168 (1967).
- [9] J.L. Bobin, Y.A. Durand, Ph. P. Langer and G. Tonon, J. Appl. Phys. 39, 4184 (1968).
- [10] D.C. Emmony and J. Irving, J. Phys. D 2, 1186 (1969).
- [11] L.I. Sedov, *Similarity and Dimensional Methods in Mechanics* (Academic Press, New York, 1959).
- [12] H. Kurniawan, M.O. Tjia, M. Barmawi, S. Yokoi, Y. Kimura and K. Kagawa, J. Phys. D 28, 879 (1995).
- [13] K. Kagawa, K. Kawai, M. Tani and T. Kobayashi, Appl. Spectrosc. 48, 198 (1994).
- [14] M. Marpaung, M. Pardede, R. Hedwig, H. Kurniawan, T. J. Lie and K. Kagawa, Jpn. J. Appl. Phys. 39, 6B, L601 (2000).
- [15] H. Kurniawan, T.J. Lie, N. Idris, M.O. Tjia, M. Ueda and K. Kagawa, J. Spectrosc. Soc. Jpn. 50, 13 (2001).
- [16] S.N. Madjid, I. Kitazima, T. Maruyama, T.J. Lie, M.O. Tjia and H. Kurniawan, Appl. Spectrosc. 57, 874 (2003).
- [17] M.M. Suliyanti, R. Hedwig, H. Kurniawan and K. Kagawa, Jpn. J. Appl. Phys. 37, 6628 (1998).
- [18] Y.I. Lee, N. Idris, Koo H. Kurniawan, T.J. Lie, K. Tsuyuki, S. Miura and K. Kagawa, Curr. Appl. Phys. (*in press*).
- [19] D.B. Chrisey and G.K. Hubler (eds), *Pulsed Laser Deposition* of Thin Films (John Wiley & Sons, New York, 1994).
- [20] J.M. Green, W.T. Silvast and O.R. Wood II, J. Appl. Phys. 48, 2753 (1977).
- [21] M. Pardede, H. Kurniawan, T.J. Lie, M.O. Tjia, Y.I. Lee and K. Kagawa, Jpn. J. Appl. Phys. 43, 7524 (2004).
- [22] W.S. Budi, W.T. Baskoro, M. Pardede, H. Kurniawan, M. O. Tjia and K. Kagawa, Appl. Spectrosc. 53, 1347 (1999).
- [23] K. Kagawa, T.J. Lie, R. Hedwig, S.N. Abdulmadjid, M.M. Suliyanti and H. Kurniawan, Jpn. J. Appl. Phys. 39, 2643 (2000).
- [24] A.M. Marpaung, R. Hedwig, M. Pardede, H. Kurniawan, M.O. Tjia and K. Kagawa, Spectrochim. Acta B 55, 1591 (2000).
- [25] R. Krasniker, V. Bulatov and I. Schechter, Spectrochim. Acta B **56**, 609 (2001).
- [26] H. Kurniawan, K. Kagawa, M. Okamoto, M. Ueda, T. Kobayashi and S. Nakashima, Appl. Spectrosc. 50, 299 (1996).

- [27] A.M. Marpaung, H. Kurniawan, M.O. Tjia and K. Kagawa, J. Phys. D 43, 758 (2001).
- [28] N. Idris, H. Kurniawan, T.J. Lie, M. Pardede, H. Suyanto, R. Hedwig, T. Kobayashi, K. Kagawa and T. Maruyama, Jpn. J. Appl. Phys. 43, 4221 (2004).
- [29] N. Idris, S. Terai, T.J. Lie, H. Kurniawan, T. Kobayashi, K. Kagawa and T. Maruyama, Appl. Spectros. 59, 115 (2005).
- [30] Koo H. Kurniawan, T.J. Lie, M. Pardede, R. Hedwig, M. M. Suliyanti, S.N. Abdulmadjid, Y.I. Lee and K. Kagawa, Appl. Phys. B. 85, 4, 631 (2006).
- [31] K. Kagawa, Y. Matsuda, S. Yokoi and S. Nakajima, J. Spectrosc. Soc. Jpn. 36, 400 (1987).
- [32] K. Kagawa and Y. Matsuda, J. Anal. Atom. Spectrochem. 3, 415 (1984).
- [33] Koo H. Kurniawan, M.M. Suliyanti, T.J. Lie, K. Kagawa and M.O. Tjia, Spectrochim. Acta Part B 56, 1407 (2001).
- [34] N. Idris, T.J. Lie, H. Kurniawan, Y.I. Lee, T. Kobayashi and K. Kagawa, Program and Abstracts Book of the International Conference on Laser-Induced Plasma Spectroscopy (LIBS 2006) (Montreal, Canada 2006) p. 113.
- [35] T.J. Lie, Koo H. Kurniawan, R. Hedwig, M. Pardede, M. O. Tjia, N. Idris, T. Kobayashi, Y.I. Lee and K. Kagawa, Jpn. J. Appl. Phys. 44, 202 (2005).
- [36] D.A. Cremers and L.J. Radziemski, Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (John Wiley and Sons, Ltd, England, 2006).
- [37] K. Kagawa, N. Idris, M. Wada, H. Kurniawan, K. Tsuyuki and S. Miura, Appl. Spectrosc. **58**, 887 (2004).
- [38] K. Tsuyuki, S. Miura, N. Idris, Koo H. Kurniawan, T.J. Lie

かがわきいちろう 香川喜一郎

会(Laser Induced Plasma Spectroscopy)の国際委員, 1976

年仁科記念奨励金を受ける.所属学会:日本物理学会,応用

物理学会、日本分光学会、レーザー学会、雪氷学会、物理教

育学会.

1944年12月15日生, 1976年甲南大学大学院

博士課程修了, 1977年福井大学教育学部助

教授,2000年福井大学教育地域科学部教 授,専門はレーザー分光学,現在,国際学 and K. Kagawa, Appl. Spectrosc. 60, 61 (2006).

- [39] K.H. Kurniawan, T.J. Lie, N. Idris, T. Kobayashi, T. Maruyama, K. Kagawa, M.O. Tjia and A.N. Chumakov, J. Appl. Phys. 96, 6859 (2004).
- [40] Koo H. Kurniawan and K. Kagawa, Appl. Spectrosc. Rev. 41, 99 (2006).
- [41] 文部省17年度原子力システム開発事業「基礎研究開発分 野若手対象型研究開発」採択「レーザー光による原子炉 材料中のオンサイト水素分析技術の開発」,代表:福元 謙一.
- [42] N. Idris, T. Kobayashi, H. Kurniawan, T.J. Lie, T. Murayama and K. Kagawa, Jpn. J. Appl. Phys. 43, 7531 (2004).
- [43] Koo H. Kurniawan, T.J. Lie, M.M. Suliyanti, R. Hedwig, S.N. Abdulmadjid, M. Pardede, N. Idris, T. Kobayashi, Y. Kusumoto, K. Kagawa and M.O. Tjia, J. Appl. Phys. 98, 093302 (2005).
- [44] Koo H. Kurniawan, T.J. Lie, M.M. Suliyanti, R. Hedwig, M. Pardede, Davy P. Kurniawan, Y. Kusumoto and K. Kagawa, Anal. Chem. 78, 5768 (2006).
- [45] A.W. Miziolek, V. Palleschi and I. Schechter (Eds), Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Fundamentals and Applications (Cambridge University Press, New York, 2006).
- [46] J. Scaffidi, S.M. Angel and D.A. Cremers, Anal. Chem. 1, 25 (2006).
- [47] K. Kagawa, N. Idris, M. Ramli, H. Niki, K. Fukumoto, T. Maruyama, T.J. Lie and H. Kurniawan, Program and Abstracts Book of the International Conference on Laser-Induced Plasma Spectroscopy (LIBS2006) (Montreal, Canada 2006) p. 69.



## Nasrullah IDRIS

Born on July 3, 1976 in Aceh, Indonesia. He obtained bachelor of science (B.Sc.) degree in Physics from Faculty of Science, Syiah Kuala University, Aceh, Indonesia on 1998.

He then studied in Graduate School of Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Jakarta and acquired his master degree of engineering (M. Eng.) on 2001. On September 2005, he was graduated by Faculty of Engineering, University of Fukui and was conferred degree of doctor of engineering (D. Eng.) in Fiber Amenity Engineering. The topic of his doctoral dissertation was study on atomic emission spectroscopy using laser-induced plasma. His research interest is mechanistic studies on laser-induced plasma and its applications to various fields including spectrochemical analysis, and laser processing. Currently, he is pursuing postdoctoral research in University of Fukui, Japan under fellowship of Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).